

表面・薄膜研究、産業利用のための超高真空技術

主催 日本真空学会東海支部

[日時・会場]

平成 27 年 4 月 15 日(水) 16:30~18:00 名古屋工業大学

(会場の部屋は申し込み時にお知らせします)

参加のおすすめ

超高真空下での表面・薄膜研究、製品製造を行なうには、その目的に最適化した超高真空装置を製作することが望まれます。しかしながら予算等の制限により、新しい装置の製作や既存の装置の改良を自分で行なう必要に迫られることも少なくありません。また、フラットパネルディスプレイ、半導体産業などの分野でも、製品の歩留まりを改善するために超高真空技術が必要不可欠です。そこで本スクールコースでは、超高真空装置を製作、改良する上で必要な知識とノウハウを、事例に基づき丁寧に説明します。今年 4 月に表面・薄膜・フラットパネルディスプレイ・半導体関連分野の研究室、メーカーに配属されたばかりの方、装置製作、装置改良の技術をさらに磨きたいと考えておられる方は是非受講ください。

参加要領

参加費(テキスト代、税込み)	非会員、一般 真空学会正会員 真空学会法人会員に所属する個人 学生	3,000 円 2,000 円 2,000 円 0 円
テキスト	講義で使用する PPT ファイルを印刷したもの	
定員	50名	
申込開始時期(予定)	平成 27 年 3 月下旬	
講師	間瀬一彦(高エネルギー加速器研究機構)	
問合せ先	〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 名古屋工業大学 市村正也 TEL. 052-735-5453 e-mail: ichimura.masaya@nitech.ac.jp	

講義

テーマ	内容
表面・薄膜研究・産業利用のための超高真空技術 (1 時間 30 分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 超高真空技術の基礎 2. 超高真空材料 3. 真空ポンプと真空計 4. 超高真空装置製作技術 5. 試料マニピュレーター、試料ホルダー 6. 蒸着源など 7. 安全